

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成19年4月5日(2007.4.5)

【公表番号】特表2004-532263(P2004-532263A)

【公表日】平成16年10月21日(2004.10.21)

【年通号数】公開・登録公報2004-041

【出願番号】特願2003-500061(P2003-500061)

【国際特許分類】

C 07 B 61/00 (2006.01)

C 07 D 223/22 (2006.01)

C 07 D 491/044 (2006.01)

【F I】

C 07 B 61/00 3 0 0

C 07 D 223/22

C 07 D 491/044

【手続補正書】

【提出日】平成19年2月9日(2007.2.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

10,11-ジヒドロ-10-ヒドロオキシ-5H-ジベンズ/b,f/アゼピン-5-カルボキシアミド(1)の製造方法であって、下記工程を含む；カルバマゼピン(3)を実質的に不活性な溶媒においてペルオキシ酢酸及び金属触媒と反応させ、11a,10b-ジヒドロ-6H-ジベンズ/b,f/オキシレノ[d]アゼピン-6-カルボキシアミド(5)を製造し、続いて、水素供与体及び金属触媒の存在下において、触媒的転移水素化により、又はそれにかわり金属触媒の存在下においてガス状水素による触媒的水素化により、11a,10b-ジヒドロ-6H-ジベンズ/b,f/オキシレノ[d]アゼピン-6-カルボキシアミド(5)の開環を行うことにより、10,11-ジヒドロ-10-ヒドロオキシ-5H-ジベンズ/b,f/アゼピン-5-カルボキシアミド(1)を製造する、前記方法。